PACS 73.20.Mf; 52.35.Mw; 42.65.Re

Возбуждение поверхностных волн в проводнике коротким лазерным импульсом

С.А.Урюпин, А.А.Фролов

Изучена возможность возбуждения поверхностных волн в проводнике, на который воздействует падающее вдоль нормали к поверхности сфокусированное фемтосекундное лазерное излучение. Показано, что зависящая от времени пондеромоторная сила приводит к возбуждению поверхностных волн в терагерцевом диапазоне частот. Показано также, что полная энергия и амплитуда импульса поверхностных волн возрастает с увеличением эффективной частоты столкновений электронов.

Ключевые слова: поверхностная волна, фемтосекундный лазерный импульс, терагерцевый диапазон частот, частота столкновений.

1. Введение

Интерес к изучению поверхностных волн обусловлен не только их необычными физическими свойствами, но и возможностью использования этих волн для решения важных прикладных задач, таких как диагностика поверхности [1], генерация электронных пучков [2], генерация терагерцевого излучения [3]. Линейной теории поверхностных волн в проводниках посвящена обширная литература (см., напр., книги [1,4] и цитируемые в них работы). В рамках линейной теории весьма детально описаны законы дисперсии волн и методы их возбуждения. Нелинейные методы возбуждения изучены в существенно меньшей степени. Вместе с тем в экспериментах по взаимодействию фемтосекундных импульсов лазерного излучения с проводниками, когда наряду с генерацией гармоник [5] и терагерцевого излучения [6] происходит возбуждение поверхностных волн, возникает необходимость в выходе за рамки линейной теории. Указания на необходимость разработки нелинейной теории возбуждения поверхностных волн есть, в частности, в экспериментах [7,8]. Ранее обсуждались такие нелинейные механизмы возбуждения поверхностных волн, как вынужденное комптоновское рассеяние [9], мгновенная пространственная модуляция показателя преломления в области воздействия лазерного УКИ [10, 11], параметрический распад волны накачки на две поверхностные волны [12]. В [13] развита теория нелинейного возбуждения поверхностных волн при прохождении лазерного импульса через границу плазма-вакуум.

В настоящей работе, в отличие от [9]–[13], рассмотрен еще один способ возбуждения поверхностных волн в проводнике, который реализуется при пондеромоторном воздействии сфокусированного импульсного лазерного излучения. Порождаемая лазерным импульсом пондеромоторная сила приводит к направленному движению электронов. При этом в скин-слое проводника возникает изменяющийся за время действия импульса вихревой ток. Этот медленно изменяющийся ток является источником низкочастотного электромагнитного поля, которое высвечивается из металла в окружающее пространство. В разд.2 приведена необходимая информация о форме воздействующего импульса и виде пондеромоторного потенциала в проводнике. Возникающее благодаря неоднородности и нестационарности пондеромоторного потенциала низкочастотное поле в проводнике изучено в разд.3. Отвечающее поверхностной волне низкочастотное поле в вакууме описано в разд.4. Там же найдены компоненты фурье-образов низкочастотного поля в вакууме и проводнике. Распределение энергии по частотам, полная энергия и структура магнитного поля поверхностной волны в волновой зоне описаны в разд.5 применительно к воздействию на проводник гауссова импульса. Показано, что распределение энергии по частотам имеет колоколообразный вид с максимумом вблизи частоты $\sim 1/\tau_*$, где $\tau_* = \tau \sqrt{1 + R^2/L^2}$, время τ определяет длительность гауссова импульса $t_{\rm p} = 2\tau \sqrt{\ln 2}$, R характеризует размер фокального пятна, а $L = c\tau$ – длину импульса, с – скорость света. Положение данного максимума почти не зависит от частоты столкновений электронов в низкочастотном поле v_s . Если $v_s \tau_* \ll 1$, то величина максимума не зависит от v_s, а в пределе частых столкновений электронов, когда $v_s \tau_* \gg 1$, она возрастает пропорционально $\sqrt{v_s \tau_*}$. Вследствие этого и полная энергия поверхностной волны возрастает пропорционально $\sqrt{v_s \tau_*}$. Установлено, что поверхностная волна распространяется в виде импульса электромагнитного поля, длительность которого порядка т..

2. Высокочастотное поле и пондеромоторный потенциал

Рассмотрим воздействие на проводник, занимающий полупространство z > 0, импульса лазерного излучения,

С.А.Урюпин. Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Россия, 119991 Москва, Ленинский просп., 53; Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Россия, 115409 Москва, Каширское ш., 31; e-mail: uryupin@sci.lebedev.ru

А.А.Фролов. Объединенный институт высоких температур РАН, Россия, 125412 Москва, ул. Ижорская, 13, стр. 2

Поступила в редакцию 18 июня 2013 г., после доработки – 5 сентября 2013 г.

распространяющегося вдоль оси z. Предположим, что несущая частота импульса ω_0 много больше $1/\tau$ и излучение слабо сфокусировано в область, характерный размер которой R много больше c/ω_0 . Без значительного ограничения общности будем считать, что импульс имеет гауссово распределение интенсивности в плоскости xy. В этих предположениях электрическое поле падающего импульса представим в виде

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{L}}^{\mathrm{inc}}(\boldsymbol{r},t) = \frac{1}{2}\boldsymbol{E}_{\mathrm{L}}\left(t - \frac{z}{c}\right) \exp\left[-\mathrm{i}\omega_{0}\left(t - \frac{z}{c}\right) - \frac{\rho^{2}}{2R^{2}}\right]$$

+ компл. сопр., (1)

где $E_{\rm L}(t)$ – слабо изменяющаяся за время $\sim \tau$ напряженность электрического поля на оси z; $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$; $r = (\rho, z)$. Ограничимся рассмотрением воздействия поля (1) в условиях, когда несущая частота излучения ω_0 и частота столкновений электронов в высокочастотном поле $v_{\rm h}$ удовлетворяют неравенству

$$|\omega_0 + i\nu_h| \gg |\kappa_L(\omega_0)|\nu, \qquad (2)$$

где v – характерная скорость электронов, а волновое число $\kappa_{\rm L}(\omega_0)$ определяет масштаб изменения поля вдоль оси z в проводнике $\delta \sim 1/|\kappa_{\rm L}(\omega_0)|$:

$$\kappa_{\rm L}(\omega_0) = \frac{\omega_0}{c} \sqrt{\frac{\omega_{\rm p}^2}{\omega_0(\omega_0 + i\nu_{\rm h})} - \varepsilon_0(\omega_0)} \,. \tag{3}$$

В формуле (3) $\omega_{\rm p}$ – плазменная частота, а $\varepsilon_0(\omega_0) = \varepsilon_0'(\omega_0) + i\varepsilon_0''(\omega_0)$ – вклад в диэлектрическую проницаемость проводника связанных электронов и решетки. В этих условиях поле (1) создает в проводнике неоднородное поле

$$E_{\rm L}(\mathbf{r},t) = E_{\rm L}(t) \frac{\omega_0}{\omega_0 + \mathrm{i}c\kappa_{\rm L}(\omega_0)} \exp\left[-\mathrm{i}\omega_0 t - \kappa_{\rm L}(\omega_0)z - \frac{\rho^2}{2R^2}\right]$$

+ компл. сопр., $z > 0.$ (4)

Это поле оказывает пондеромоторное воздействие на электроны. В том случае, когда несущая частота ω_0 значительно превышает частоту столкновений электронов v_h , отвечающий полю (4) пондеромоторный потенциал имеет вид

$$\Phi(\mathbf{r},t) = \frac{e^2 \mathbf{E}_{\rm L}^2(t)}{m|\omega_0 + \mathrm{i}c\kappa_{\rm L}(\omega_0)|^2} \exp\left[-2\operatorname{Re}\kappa_{\rm L}(\omega_0)z - \frac{\rho^2}{R^2}\right], \quad (5)$$

где *е* – заряд, а *m* – эффективная масса электрона.

3. Низкочастотное поле в проводнике

Пондеромоторное воздействие импульса с медленно изменяющейся во времени амплитудой поля приводит к возникновению низкочастотного тока и низкочастотного поля в проводнике. Для определения плотности низкочастотного тока воспользуемся уравнением

$$\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t) + v_{s}\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t) = \frac{\omega_{p}^{2}}{4\pi} \Big[\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) - \frac{1}{e}\nabla\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{r},t)\Big],\tag{6}$$

где $E(\mathbf{r}, t)$ – низкочастотное электрическое поле в проводнике; v_s – частота столкновений электронов в низкочастотном поле, которая отличается от частоты v_h вследствие зависимости частоты электрон-электронных столкновений от частоты поля [14]. Для описания низкочастотного электромагнитного поля уравнение (6) следует дополнить уравнениями Максвелла для электрического поля $E(\mathbf{r}, t)$ и магнитного поля $B(\mathbf{r}, t)$:

$$\operatorname{rot} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t), \tag{7}$$

$$\operatorname{rot} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t) = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \boldsymbol{D}(\boldsymbol{r},t) + \frac{4\pi}{c} \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t), \qquad (8)$$

где D(r, t) – электрическая индукция. При построении решения уравнений (6)–(8) воспользуемся преобразованием Фурье по времени *t* и координате $\rho = (x, y)$:

$$F(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega) = \int dt d\rho \exp(i\omega t - i\mathbf{k}_{\perp}\rho) F(\mathbf{r}, t),$$

$$F(\mathbf{r}, t) = \int \frac{d\omega d\mathbf{k}_{\perp}}{(2\pi)^3} \exp(-i\omega t + i\mathbf{k}_{\perp}\rho) F(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega),$$
(9)

где $k_{\perp} = (k_x, k_y)$ – волновой вектор в плоскости *xy*, а $F(\mathbf{r}, t)$ – одна из функций $j(\mathbf{r}, t)$, $E(\mathbf{r}, t)$, $B(\mathbf{r}, t)$ или $D(\mathbf{r}, t)$. В силу аксиальной симметрии пондеромоторного потенциала (5) плотность тока, поля и вектор индукции имеют вид

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t) = (j_{\rho}(\mathbf{r},t), 0, j_{z}(\mathbf{r},t)), \ \mathbf{E}(\mathbf{r},t) = (E_{\rho}(\mathbf{r},t), 0, E_{z}(\mathbf{r},t)),$$
$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t) = (0, B_{\varphi}(\mathbf{r},t), 0), \ \mathbf{D}(\mathbf{r},t) = (D_{\rho}(\mathbf{r},t), 0, D_{z}(\mathbf{r},t)).$$

После преобразования Фурье из уравнений (7) и (8) получаем систему уравнений для фурье-образов компонент электрического и магнитного полей:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}E_{\rho}(\boldsymbol{k}_{\perp},z,\omega) - \mathrm{i}k_{\perp}E_{z}(\boldsymbol{k}_{\perp},z,\omega) = \frac{\mathrm{i}\omega}{c}B_{\varphi}(\boldsymbol{k}_{\perp},z,\omega),$$
$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}B_{\varphi}(\boldsymbol{k}_{\perp},z,\omega) = -\frac{\mathrm{i}\omega}{c}\varepsilon_{0}(\omega)E_{\rho}(\boldsymbol{k}_{\perp},z,\omega) + \frac{4\pi}{c}j_{\rho}(\boldsymbol{k}_{\perp},z,\omega),(10)$$

$$\mathrm{i}k_{\perp}B_{\varphi}(\boldsymbol{k}_{\perp},z,\omega)=-\frac{\mathrm{i}\omega}{c}\varepsilon_{0}(\omega)E_{z}(\boldsymbol{k}_{\perp},z,\omega)+\frac{4\pi}{c}j_{z}(\boldsymbol{k}_{\perp},z,\omega), z>0.$$

При преобразовании уравнения (8) использовалась связь фурье-образа вектора индукции и электрического поля $D(r, \omega) = \varepsilon_0(\omega) E(r, \omega)$. Уравнения (6) и (10) справедливы в области z > 0. Принимая во внимание явный вид пондеромоторного потенциала (5), продолжим эти уравнения и искомые функции в область z < 0:

$$B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp}, -z, \omega) = -B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega), \quad E_{\rho}(\mathbf{k}_{\perp}, -z, \omega) = E_{\rho}(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega),$$
$$E_{z}(\mathbf{k}_{\perp}, -z, \omega) = -E_{z}(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega), \quad \Phi(\mathbf{k}_{\perp}, -z, \omega) = \Phi(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega), \quad (11)$$
$$j_{z}(\mathbf{k}_{\perp}, -z, \omega) = -j_{z}(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega), \quad j_{\rho}(\mathbf{k}_{\perp}, -z, \omega) = j_{\rho}(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega).$$

Учитывая соотношения (11), из уравнения (6) после преобразования Фурье по времени и координатам находим фурье-образ плотности тока

$$j(\boldsymbol{k},\omega) = \frac{\mathrm{i}}{4\pi} \frac{\omega_{\mathrm{p}}^{2}}{(\omega + \mathrm{i}v_{\mathrm{s}})} \Big[\boldsymbol{E}(\boldsymbol{k},\omega) - \mathrm{i}\frac{\boldsymbol{k}}{e} \boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{k},\omega) \Big].$$
(12)

Далее, используя выражения (11), (12) и преобразование Фурье по координате z (см. (9)), из уравнений (10) получаем соотношения

$$k_{z}E_{\rho}(\mathbf{k},\omega) - k_{\perp}E_{z}(\mathbf{k},\omega) = \frac{\omega}{c}B_{\varphi}(\mathbf{k},\omega),$$

$$-ik_{z}B_{\varphi}(\mathbf{k},\omega) + \Delta B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp},\omega)$$

$$= -\frac{i\omega}{c}\varepsilon(\omega)E_{\rho}(\mathbf{k},\omega) + \frac{1}{c}\frac{\omega_{p}^{2}}{(\omega+iv_{s})}\frac{k_{\perp}}{e}\Phi(\mathbf{k},\omega),$$

$$ik_{\perp}B_{\varphi}(\mathbf{k},\omega) = -\frac{i\omega}{c}\varepsilon(\omega)E_{z}(\mathbf{k},\omega) + \frac{1}{c}\frac{\omega_{p}^{2}}{(\omega+iv_{s})}\frac{k_{z}}{e}\Phi(\mathbf{k},\omega),$$
(13)

где

$$\Delta B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp},\omega) = B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp},z=+0,\omega) - B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp},z=-0,\omega)$$
$$= 2B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp},z=+0,\omega)$$

– скачок функции $B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega)$ на плоскости z = 0 из-за нечетного продолжения в область z < 0;

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0(\omega) - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\nu_s)}$$
(14)

– диэлектрическая проницаемость проводника при условии $|\omega + iv_s| \gg kv$. Решение системы уравнений (13) для компонент фурье-образов электромагнитного поля имеет вид

$$B_{\varphi}(\boldsymbol{k},\omega) = \frac{2ik_zc^2}{\omega^2\varepsilon(\omega) - k^2c^2}B_{\varphi}(\boldsymbol{k}_{\perp}, z = +0, \omega), \qquad (15)$$

$$E_{\rho}(\boldsymbol{k},\omega) = \frac{2i\omega c}{k^{2}}B_{\varphi}(\boldsymbol{k}_{\perp}, z = +0, \omega)$$

$$\times \left[\frac{k_{z}^{2}}{\omega^{2}\varepsilon(\omega) - k^{2}c^{2}} + \frac{k_{\perp}^{2}}{\omega^{2}\varepsilon(\omega)}\right] - \frac{ik_{\perp}\omega_{p}^{2}}{\omega(\omega + iv_{s})}\frac{\boldsymbol{\Phi}(\omega, \boldsymbol{k})}{\varepsilon\varepsilon(\omega)}, (16)$$

$$E_{z}(\mathbf{k},\omega) = -B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp}, z = +0,\omega)$$

$$\times \frac{2i}{\omega\varepsilon(\omega)} \frac{k_{z}k_{\perp}c^{3}}{\omega^{2}\varepsilon(\omega) - k^{2}c^{2}} - \frac{ik_{z}\omega_{p}^{2}}{\omega(\omega + iv_{s})} \frac{\Phi(\omega, \mathbf{k})}{\varepsilon\varepsilon(\omega)}.$$
(17)

Используя обратное преобразование Фурье по координате *z* (см. (9)), из соотношений (15)–(17) находим выражение для функций $B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega)$, $E_{\rho}(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega)$ и $E_{z}(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega)$ в проводнике:

$$B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega) = B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp}, z = +0, \omega) \exp(-\kappa z), \qquad (18)$$

$$E_{\rho}(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega) = \frac{1c\kappa}{\omega\varepsilon(\omega)} B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp}, z = +0, \omega) \exp(-\kappa z) - \frac{\mathrm{i}k_{\perp}\omega_{\mathrm{p}}^{2}}{\omega(\omega + \mathrm{i}v_{\mathrm{r}})} \frac{\Phi(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega)}{\varepsilon\varepsilon(\omega)},$$
(19)

$$E_{z}(\boldsymbol{k}_{\perp}, z, \omega) = -\frac{ck_{\perp}}{\omega\varepsilon(\omega)}B_{\varphi}(\boldsymbol{k}_{\perp}, z = +0, \omega)\exp(-\kappa z)$$
$$-\frac{\omega_{p}^{2}}{\omega(\omega + iv_{s})}\frac{\partial}{\partial z}\frac{\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{k}_{\perp}, z, \omega)}{e\varepsilon(\omega)}, \qquad (20)$$

где

$$\kappa = \sqrt{k_{\perp}^2 - \omega^2 \varepsilon(\omega)/c^2} = \kappa_1 - i\kappa_2; \ \varepsilon(\omega) = \varepsilon'(\omega) + i\varepsilon''(\omega);$$

$$\kappa_s = \frac{1}{c\sqrt{2}} \left\{ \sqrt{\left[k_{\perp}^2 c^2 - \omega^2 \varepsilon'(\omega)\right]^2 + \left[\omega^2 \varepsilon''(\omega)\right]^2} - (-1)^s \left[k_{\perp}^2 c^2 - \omega^2 \varepsilon'(\omega)\right] \right\}^{1/2}, \ s = 1, 2.$$
(21)

Величина 1/к₁ определяет размер области локализации низкочастотного поля в проводнике вблизи его поверхности.

4. Низкочастотное поле в вакууме. Поверхностная волна

Низкочастотное электромагнитное поле в вакууме, когда z < 0, описывается системой уравнений (10), если в них положить $j(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega) = 0$, $\varepsilon_0(\omega) = 1$. В дальнейшем будем рассматривать только ту часть электромагнитного поля в вакууме, которая отвечает поверхностной волне, поле которой локализовано вблизи границы проводника. Таким образом, ищем решение видоизмененной системы уравнений (10) при условии

$$k_{\perp}c > |\omega|. \tag{22}$$

Для таких k_{\perp} и ω имеем следующее решение:

$$B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega) = B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp}, z = -0, \omega) \exp(\kappa_0 z), \qquad (23)$$

$$E_{\rho}(\boldsymbol{k}_{\perp}, z, \omega) = -i \frac{c\kappa_0}{\omega} B_{\varphi}(\boldsymbol{k}_{\perp}, z = -0, \omega) \exp(\kappa_0 z), \qquad (24)$$

$$E_{z}(\boldsymbol{k}_{\perp}, z, \omega) = -\frac{ck_{\perp}}{\omega}B_{\varphi}(\boldsymbol{k}_{\perp}, z = -0, \omega)\exp(\kappa_{0}z), \qquad (25)$$

где $\kappa_0 = \sqrt{k_{\perp}^2 - \omega^2/c^2}$; $B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp}, z = -0, \omega)$ – неизвестная функция. Для определения функций $B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp}, z = +0, \omega)$ и $B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp}, z = -0, \omega)$ воспользуемся условиями непрерывности тангенциальных компонент электромагнитного поля на границе проводника. Приравнивая компоненты $B_{\varphi}(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega)$ и $E_{\rho}(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega)$ на плоскости z = 0, из формул (18), (19), (23), (24), находим

$$B_{\varphi}(\boldsymbol{k}_{\perp}, z = -0, \omega) = B_{\varphi}(\boldsymbol{k}_{\perp}, z = +0, \omega)$$
$$= \frac{k_{\perp}\omega_{\rm p}^2}{(\omega + i\nu_{\rm s})c[\kappa + \kappa_0\varepsilon(\omega)]} \frac{\Phi(\boldsymbol{k}_{\perp}, z = 0, \omega)}{e}.$$
 (26)

Соотношения (23)–(26) полностью определяют фурьеобразы компонент локализованного у поверхности проводника низкочастотного поля в вакууме. Эти фурьеобразы, а также описываемые формулами (18)–(20), пропорциональны фурье-образу пондеромоторного потенциала на поверхности проводника $\Phi(\mathbf{k}_{\perp}, z = 0, \omega)$. Для пондеромоторного потенциала (5) фурье-образ

$$\Phi(\mathbf{k}_{\perp}, z, \omega) = \frac{e^2}{m} \frac{\pi R^2}{|\omega_0 + ic\kappa_{\rm L}(\omega_0)|^2} \\ \times \exp\left[-2\operatorname{Re}\kappa_{\rm L}(\omega_0)z - \frac{k_{\perp}^2 R^2}{4}\right] \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}t \boldsymbol{E}_{\rm L}^2(t) \exp(i\omega t). \quad (27)$$

Выражения (18)–(27) позволяют найти отвечающее поверхностной волне электромагнитное поле в вакууме и в проводнике. Выражения (23)–(25) пригодны для описания только части поля, локализованной у поверхности проводника. Эта часть поля определяется фурье-образами полей, имеющих достаточно большие волновые векторы в плоскости, компланарной поверхности проводника: $k_{\perp}c > |\omega|$ (22). Поэтому, восстанавливая зависимость поля от координаты ρ с помощью обратного преобразования Фурье по ρ (9), ограничим снизу область интегрирования по k_{\perp} величиной $|\omega|/c$. Тогда из формул (18), (22), (26), (27) для зависящей от частоты и локализованной у поверхности проводника азимутальной компоненты фурье-образа магнитного поля получаем

$$B_{\varphi}(\mathbf{r},\omega) = \frac{\omega_{\rm p}^2}{|\omega_0 + \mathrm{i}c\kappa_{\rm L}(\omega_0)|^2} \frac{e}{mc} \frac{\pi R^2}{\omega + \mathrm{i}v_{\rm s}} \int_{\omega/c}^{\infty} \frac{k_{\perp}^2 \mathrm{d}k_{\perp}}{2\pi} \frac{J_0(k_{\perp}\rho)}{\kappa + \kappa_0 \varepsilon(\omega)}$$

$$\times \exp\left(-\frac{k_{\perp}^2 R^2}{4}\right) [\eta(-z) \exp(\kappa_0 z) + \eta(z) \exp(-\kappa z)]$$

$$\times \int_{-\infty}^{+\infty} dt \boldsymbol{E}_{\mathrm{L}}^2(t) \exp(\mathrm{i}\omega t), \ \omega > 0,$$
(28)

где $\eta(z)$ – единичная ступенчатая функция Хевисайда; $J_0(k_{\perp}\rho)$ – функция Бесселя нулевого порядка. В знаменателе формулы (28) стоит функция $\kappa + \kappa_0 \varepsilon(\omega)$, которую, учитывая явные выражения для κ_0 и κ , можно представить в виде

$$\kappa + \kappa_0 \varepsilon(\omega) = \frac{1 - \varepsilon^2(\omega)}{\kappa - \kappa_0 \varepsilon(\omega)} \left[k_\perp^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon(\omega) + 1} \right].$$
 (29)

Выражение (29) равно нулю, если

$$k_{\perp}^{2} = \frac{\omega^{2}}{c^{2}} \left[1 + \frac{1}{|\varepsilon'(\omega)| - 1 - i\varepsilon''(\omega)} \right], \tag{30}$$

где $\varepsilon''(\omega) = \omega_p^2 v_s / [\omega(\omega^2 + v_s^2)] + \varepsilon_0''(\omega) > 0$ и учтено, что для часто реализующихся условий $\omega_p^2 \gg (\omega^2 + v_s^2) |\varepsilon_0'(\omega)|$ и $|\varepsilon'(\omega)| = -\varepsilon'(\omega) = \omega_p^2 / (\omega^2 + v_s^2) - \varepsilon_0'(\omega) > 0$. Отметим, что в области низких частот абсолютное значение действительной части диэлектрической проницаемости обычно много больше единицы, $|\varepsilon'(\omega)| \gg 1$, и в знаменателе формулы (30) можно пренебречь единицей:

$$k_{\perp} \simeq \frac{\omega}{c} \left[1 + \frac{1}{2} \frac{1}{|\varepsilon'(\omega)| - i\varepsilon''(\omega)} \right].$$
(31)

Соотношения (30) и (31) дают закон дисперсии волн, распространяющихся вдоль поверхности проводника (см., напр., [4]). Тем самым выражение под интегралом в формуле (28) имеет полюс первого порядка в плоскости комплексной переменной k_{\perp} . Рассмотрим низкочастотное поле на больших расстояниях от области фокального пятна, когда выполняются неравенства $\rho \gg R$, c/ω . В этом случае при вычислении интеграла по переменной k_{\perp} можно воспользоваться асимптотическим представлением функции Бесселя:

$$J_0(k_{\perp}\rho) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi k_{\perp}\rho}} \cos\left(k_{\perp}\rho - \frac{\pi}{4}\right), \ k_{\perp}\rho \gg 1.$$
(32)

Для вычисления интеграла по k_{\perp} в (28) выберем контур интегрирования в плоскости k_{\perp} , как показано на рис.1. Точкой на рис.1 обозначен полюс, отвечающий поверхностной волне (30), (31). Интеграл по дуге бесконечно большого радиуса равен нулю. Интеграл вдоль луча, идущего из точки ω/c под углом $\pi/4$ к вещественной оси, при $\rho \gg R$ экспоненциально мал. Поэтому основной вклад в искомый интеграл (28) возникает от вычета в полюсе. Учитывая вклад от полюса (31) и формулу (32), из (28) находим следующее выражение для фурье-образа азимутальной компоненты магнитного поля на поверхности проводника:

$$B_{\varphi}(\rho, z = 0, \omega) \simeq -\frac{e}{mc(\omega + i\nu_{s})} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\omega_{p}^{2}}{|\omega_{0} + ic\kappa_{L}(\omega_{0})|^{2}} \left(\frac{\omega R}{c}\right)^{2}$$

$$\times [|\varepsilon'(\omega)| - i\varepsilon''(\omega)]^{-3/2} \sqrt{\frac{c}{\omega\rho}} \exp\left\{i\frac{\pi}{4} + i\frac{\omega}{2c}\rho\right]$$

$$\times \left[2 + \frac{1}{|\varepsilon'(\omega)| - i\varepsilon''(\omega)}\right] - \frac{\omega^{2}R^{2}}{4c^{2}} \left[1 + \frac{1}{|\varepsilon'(\omega)| - i\varepsilon''(\omega)}\right]$$

$$\times \int_{-\infty}^{+\infty} dt E_{L}^{2}(t) \exp(i\omega t), \quad \omega > 0. \quad (33)$$

Совершенно аналогично из (23)–(25) находим фурьеобразы компонент электромагнитного поля в вакууме:

$$E_{z}(\mathbf{r},\omega) = -B_{\varphi}(\mathbf{r},\omega),$$

$$E_{\rho}(\mathbf{r},\omega) = -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{|\varepsilon'(\omega)| - \mathrm{i}\varepsilon''(\omega)}} B_{\varphi}(\mathbf{r},\omega),$$
(34)

$$B_{\varphi}(\mathbf{r},\omega) \simeq B_{\varphi}(\rho,z=0,\omega) \exp\left[\frac{\omega z}{c\sqrt{|\varepsilon'(\omega)|-i\varepsilon''(\omega)}}\right], z<0, \omega>0,$$

а из (18)–(20), с учетом (26) и (27), – те же величины в проводнике:

$$E_{\varepsilon}(\mathbf{r},\omega) = \frac{1}{|\varepsilon'(\omega)| - i\varepsilon''(\omega)} B_{\varphi}(\mathbf{r},\omega),$$

$$E_{\rho}(\mathbf{r},\omega) = -\frac{i}{\sqrt{|\varepsilon'(\omega)| - i\varepsilon''(\omega)}} B_{\varphi}(\mathbf{r},\omega),$$

$$B_{\varphi}(\mathbf{r},\omega) \simeq B_{\varphi}(\rho, z = 0, \omega) \exp\left[-\frac{\omega z}{c} \sqrt{|\varepsilon'(\omega)| - i\varepsilon''(\omega)}\right],$$
(35)

$$z > 0, \ \omega > 0.$$



Рис.1. Контур интегрирования в формуле (28).

Выражения (33)–(35) описывают расходящуюся из области фокального пятна поверхностную волну, амплитуда которой убывает с расстоянием пропорционально $1/\sqrt{\rho}$. Согласно (33) наличие диссипации, обусловленной столкновениями электронов, а также поглощением поля решеткой и связанными электронами, приводит к затуханию поверхностной волны на больших расстояниях, когда

$$\rho \ge \rho_{\rm m} \simeq 2 \frac{c}{\omega} \frac{|\varepsilon'(\omega)|^2 + \varepsilon''^2(\omega)}{\varepsilon''(\omega)}.$$
(36)

Поэтому будем рассматривать характеристики поверхностной волны в области $\rho < \rho_{\rm m}$, когда изменением амплитуды волны из-за диссипации можно пренебречь. Такая область существует, если $\rho_{\rm m} \gg R, c/\omega$. Отметим, что область локализации поля поверхностной волны со стороны вакуума

$$\delta_{v} \simeq \frac{c}{\omega\sqrt{2}} \{ [\varepsilon'^{2}(\omega) + \varepsilon''^{2}(\omega)]^{1/2} + |\varepsilon'(\omega)| \}^{1/2}$$
(37)

значительно больше глубины проникновения поля в проводник:

$$\delta_{\rm m} \simeq \delta_{\rm v} [\varepsilon^{\prime 2}(\omega) + \varepsilon^{\prime \prime 2}(\omega)]^{-1/2} \ll \delta_{\rm v}.$$
(38)

5. Физические характеристики поверхностной волны

Для вычисления энергии W, переносимой поверхностной волной, рассмотрим цилиндрическую поверхность радиусом ρ и длиной dz, ось симметрии которой совпадает с направлением движения лазерного импульса и проходит через начало координат. За все время через эту поверхность по нормали к ней проходит энергия, равная произведению проинтегрированной по времени плотности потока энергии

$$\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}t \frac{c}{4\pi} [\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t)]$$
(39)

и элемента площадки $2\pi\rho dz$:

$$dW = 2\pi\rho dz \int_0^\infty d\omega \frac{c}{8\pi^2} \{ [E(\mathbf{r}, \omega) B^*(\mathbf{r}, \omega)] + \text{компл. conp.} \}. (40)$$

Интегрируя выражение (40) по координате z от $-\infty$ до $+\infty$ и используя соотношения (34), (35), находим энергию поверхностных волн, приходящуюся на единичный интервал частот d ω :

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}\omega} = \frac{c\rho}{2\pi} \Big[\int_{-\infty}^{0} \mathrm{d}z |B_{\varphi}(\mathbf{r},\omega)|^{2} - \frac{|\varepsilon'(\omega)|}{\varepsilon'^{2}(\omega) + \varepsilon''^{2}(\omega)} \int_{0}^{+\infty} \mathrm{d}z |B_{\varphi}(\mathbf{r},\omega)|^{2} \Big].$$
(41)

Из формулы (41) и соотношений (34), (35) следует, что энергия поверхностной волны в вакууме значительно превышает ее энергию в проводнике. Вычисляя в формуле (41) интеграл по области вакуума, получаем спектральное распределение энергии поверхностных волн

$$\frac{dW}{d\omega} = \frac{\omega_{\rm p}^{\rm o}}{|\omega_0 + ic\kappa_{\rm L}(\omega_0)|^4} \frac{\sqrt{2} e^2 R^4}{8m^2 c^3} \\
\times \frac{\omega^2}{\omega^2 + v_{\rm s}^2} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} dt E_{\rm L}^2(t) \exp(i\omega t) \right]^2 \\
\times \frac{1}{\varepsilon'^2(\omega) + \varepsilon''^2(\omega)} \left[\sqrt{\varepsilon'^2(\omega) + \varepsilon''^2(\omega)} + |\varepsilon'(\omega)| \right]^{-1/2} \\
\times \exp\left\{ -\frac{\omega^2 R^2}{2c^2} \left[1 + \frac{|\varepsilon'(\omega)|}{\varepsilon'^2(\omega) + \varepsilon''^2(\omega)} \right] \right\}, \quad \omega > 0. \quad (42)$$

Согласно (42) распределение энергии по спектру зависит не только от физических характеристик проводника, но и от формы воздействующего импульса лазерного излучения. Исследуем подробнее спектральный состав генерируемого поля в часто обсуждаемом случае, когда форма импульса описывается распределением Гаусса:

$$\boldsymbol{E}_{\rm L}^2(t) = E_{\rm L}^2 \exp(-t^2/\tau^2). \tag{43}$$

Рассмотрим распределение (42) в типичных для многих экспериментов условиях, когда выполнены неравенства

$$\frac{\omega_{\rm p}^2}{\omega^2 + v_{\rm s}^2} \gg |\varepsilon_0'(\omega)|, \quad \frac{\omega_{\rm p}^2}{\omega^2 + v_{\rm s}^2} \frac{v_{\rm s}}{\omega} \gg |\varepsilon_0''(\omega)|,$$
$$\omega_0 \gg v_{\rm h}, \quad \frac{\omega_{\rm p}^2}{\omega_0^2} \gg |\varepsilon_0'(\omega_0)|. \tag{44}$$

Для импульса (43) при условиях (44) выражение (42) принимает вид

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{8\sqrt{2}\,e^2}{\sqrt{L^2 + R^2}} \frac{W_{\rm L}^2}{m^2 c^4} \frac{1}{\omega_{\rm p}^5 \tau_*^5} I(\Omega),\tag{45}$$

где $\Omega = \omega \tau_*$ – безразмерная частота; $W_{\rm L} = \sqrt{\pi} E_{\rm L}^2 R^2 L/8$ – энергия лазерного импульса; безразмерная функция

$$I(\Omega) = \frac{\Omega^{9/2} \sqrt{\Omega^2 + \gamma_s^2}}{\sqrt{\Omega + \sqrt{\Omega^2 + \gamma_s^2}}} \exp\left(-\frac{\Omega^2}{2}\right), \ \gamma_s = v_s \tau_*.$$
(46)

Здесь параметр γ_s учитывает влияние столкновений электронов на распределение энергии по частотам. Описывающая спектральное распределение энергии поверх-



Рис.2. Зависимости нормированной спектральной плотности энергии $I(\Omega)$ (46) поверхностных волн от безразмерной частоты Ω при параметре $\gamma_s = 8$ (1), 4 (2), 1 (3) и 0.25 (4).

ностных волн функция (46) представлена на рис.2 для различных значений безразмерной частоты столкновений γ_s . Видно, что в спектре излучения имеется широкий максимум, положение которого слабо зависит от параметра γ_s . Вместе с тем при увеличении частоты столкновений амплитуда максимума возрастает. Для объяснения такого поведения рассмотрим функцию (46) подробнее. При $\gamma_s \ll 1$, что отвечает пределу редких столкновений, из формулы (46) получаем выражение

$$I(\Omega) \simeq \frac{\Omega^5}{\sqrt{2}} \exp\left(-\frac{\Omega^2}{2}\right). \tag{47}$$

В этом случае максимум спектрального распределения находится при $\varOmega_{\rm max}\simeq \sqrt{5}$, что соответствует частоте

$$\omega_{\max} = \frac{\sqrt{5}}{\tau \sqrt{1 + R^2 L^2}}.$$
(48)

Если за время действия лазерного импульса происходит много столкновений электронов ($\gamma_s \gg 1$), из формулы (46) имеем соотношение

$$I_{\rm s}(\Omega) \simeq \sqrt{\gamma_{\rm s}} \, \Omega^{9/2} \exp\left(-\frac{\Omega^2}{2}\right).$$
 (49)

Функция (49) имеет максимум при $\Omega_{\text{max}} = 3/\sqrt{2}$, что соответствует частоте

$$\omega_{\max} = \frac{3}{\sqrt{2}\,\tau\,\sqrt{1 + R^2/L^2}}.$$
(50)

Частоты (48) и (50) различаются незначительно, что соответствует данным, представленным на рис.2. При острой фокусировке лазерного излучения $R \ll L$, и положение максимума спектрального распределения определяется обратной длительностью лазерного импульса: $\omega_{\max} \sim 1/\tau$. С увеличением размера фокального пятна максимум смещается в область более низких частот $\omega_{\max} \sim c/R$. Также, в согласии с рис.2, из формулы (49) видно, что в пределе частых столкновений электронов максимум функции $I(\Omega)$ возрастает пропорционально $\sqrt{\gamma_s}$.

Интегрируя выражение (45) по частотам, находим полную энергию поверхностных волн

$$W = \frac{8\sqrt{2}e^2}{L} \frac{W_{\rm L}^2}{m^2 c^4} \frac{w}{w_{\rm p}^5 \tau^5 (1+R^2 L^2)^3},$$
(51)

где

$$w = \int_0^\infty \mathrm{d}\Omega I(\Omega) = \int_0^\infty \mathrm{d}\Omega \frac{\Omega^{9/2} \sqrt{\Omega^2 + \gamma_s^2}}{\sqrt{\Omega + \sqrt{\Omega^2 + \gamma_s^2}}} \exp\left(-\frac{\Omega^2}{2}\right).$$
(52)

Из формулы (51) видно, что при фиксированных энергии и длительности лазерного импульса энергия поверхностных волн максимальна при острой фокусировке, когда выполнено условие $R \ll L$. Зависимость нормированной энергии поверхностных волн (52) от частоты столкновений электронов представлена на рис.3. При больших значениях γ_s энергия возрастает пропорционально $\sqrt{\gamma_s}$. Используя приближенные формулы (47) и (49), получаем явные выражения для величины *w* при малых и больших значениях γ_s . В пределе редких столкновений электронов, когда $\gamma_s \ll 1$, интегрируя (47) по Ω , находим соотношение



1137

Рис.3. Зависимость нормированной энергии поверхностных волн w (52) от параметра γ_{s} .

$$w = \int_0^\infty \mathrm{d}\Omega \frac{\Omega^5}{\sqrt{2}} \exp\left(-\frac{\Omega^2}{2}\right) = \frac{8}{\sqrt{2}} \simeq 5.7.$$
 (53)

В пределе частых столкновений $\gamma_s \gg 1$, и для нормированной энергии поверхностных волн из (52) имеем выражение

$$w = \sqrt{\gamma_{\rm s}} \int_0^\infty \mathrm{d}\Omega \Omega^{9/2} \exp\left(-\frac{\Omega^2}{2}\right)$$
$$= 2^{7/4} \frac{21}{16} \Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \sqrt{\gamma_{\rm s}} \simeq 5.4 \sqrt{\gamma_{\rm s}} \,. \tag{54}$$

Проанализируем пространственно-временную структуру поверхностной волны на поверхности проводника, где z = 0. Применяя обратное преобразование Фурье по времени, из формул (33), (43) находим распределение магнитного поля поверхностной волны

$$B_{\varphi}(\rho, z=0, t) = -\frac{eE_{\rm L}^2 R^2 \tau}{2\sqrt{2} mc(c\tau_*)^{3/2} (\omega_{\rm p} \tau_*)^3} \frac{H(\xi)}{\sqrt{\rho}},$$
(55)

$$H(\xi) = 2\operatorname{Re}\int_0^\infty dz z^3 \sqrt{z + i\gamma_s} \exp\left(i\frac{\pi}{4} + iz\xi - \frac{z^2}{4}\right), \quad (56)$$

где $\xi = (\rho/c - t)/\tau_*$ и использовано тождество $B_{\varphi}(\rho, z = 0, -\omega) = B_{\varphi}^*(\rho, z = 0, \omega)$. Зависимость (56) представлена на рис.4 для двух значений безразмерной частоты столкновений электронов γ_s . Кривая 2 соответствует пределу, когда частота столкновений меньше $1/\tau_*$. Увеличение частоты столкнове



Рис.4. Пространственно-временная структура магнитного поля поверхностной волны (56) при $\gamma_s = 8$ (1) и 0.25 (2).

ний электронов приводит к росту амплитуды генерируемого магнитного поля, при этом одновременно происходит модификация пространственно-временного профиля поверхностной волны (кривая *I* на рис.4). В пределе частых столкновений, когда $\gamma_{\rm s} \gg 1$, из формулы (56) находим выражение

$$H(\xi) = -2\sqrt{\pi\gamma_s} \frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}\xi^3} \exp(-\xi^2)$$
$$= -8\sqrt{\pi\gamma_s}\xi(3-2\xi^2)\exp(-\xi^2). \tag{57}$$

Из рис.4 и формул (56), (57) следует, что поверхностная волна распространяется вдоль поверхности металла в виде электромагнитного импульса с длительностью порядка τ_* . При острой фокусировке лазерного излучения $R \ll L$, и длительность импульса поверхностной волны сопоставима с длительностью лазерного импульса. При увеличении размера фокального пятна длительность импульса поверхностной волны увеличивается и при $R \gg L$ становится равной R/c.

6. Заключение

Рассмотрим энергию поверхностных волн для типичных параметров лазерного воздействия на проводник. Для этого перепишем формулу (51) с учетом выражения $W_{\rm L} = I_{\rm L} \pi^{3/2} R^2 \tau$:

$$W = 8\sqrt{2}\pi^{3} \frac{e^{2}\omega_{\rm p}}{c} \left(\frac{I_{\rm L}}{m\omega_{\rm p}^{3}}\right)^{2} \frac{R^{4}L^{2}}{(R^{2}+L^{2})^{3}} w, \qquad (58)$$

где $I_{\rm L} = cE_{\rm L}^2/(8\pi)$ – плотность потока лазерного излучения. Энергия (58) при условии $R^2 = 2L^2$ имеет максимальную величину

$$W_{\rm max} \approx 52 \frac{e^2 \omega_{\rm p}}{c} \left(\frac{I_{\rm L}}{m \omega_{\rm p}^3}\right)^2 w.$$
⁽⁵⁹⁾

Приведем оценку энергии и частоты генерируемых поверхностных волн. В качестве мишени используем полупроводник с плазменной частотой $\omega_{\rm p} \approx 2 \times 10^{14} \, {\rm c}^{-1}$ и частотой столкновений электронов $v_{\rm s} \approx 10^{13} \, {\rm c}^{-1}$. Примем, что плотность потока $I_{\rm L} \approx 10^{12} \, {\rm Br/cm^2}$, длительность импульса $\tau \approx 400 \, {\rm ch}$, а несущая частота $\omega_0 \approx 2 \times 10^{14} \, {\rm c}^{-1}$. Строго го-

воря, при $\omega_0 \approx \omega_p$ формула (59) требует уточнения. Однако из сравнения выражения (59) с результатами, полученными в [13] при $\omega_0 > \omega_p$, можно заключить, что оптимальные условия генерации достигаются именно при $\omega_0 \approx \omega_p$, а формула (59) пригодна для оценок и при таких частотах. Для принятых параметров длина импульса $L \approx 120$ мкм, а *R* ≈ 170 мкм. Характеризующий влияние столкновений параметр $\gamma_s \approx 7$, и в соответствии с рис.3 величина $w \approx 30$. В этих условиях, согласно формуле (50), максимум излучения имеет место на частоте 0.5 ТГц, а полная энергия излучения (59) составляет 0.5×10⁻¹² Дж. Поскольку полная энергия в импульсе равна 6×10⁻⁴ Дж, то эффективность преобразования весьма мала – примерно 10⁻⁹. Вместе с тем, как видно из соотношения (59), в проводниках с меньшей плазменной частотой и при большей интенсивности излучения эффективность генерации можно существенно повысить. Однако выбирать слишком большую интенсивность не следует из-за эффективного нагрева электронов, а затем и решетки. Отметим также, что в металлах, где плазменная частота велика, эффективность генерации поверхностных волн при пондеромоторном воздействии падающего вдоль нормали к поверхности образца сфокусированного лазерного импульсного излучения меньше, чем в полупроводниках.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 12-02-00744) и программы Президиума РАН № 24.

- Raether H.R. Surface Plasmons on Smooth and Rough Surfaces and on Gratings (New York: Springer-Verlag, 1988, vol. 111).
- 2. Irvine S.E., Elezzabi A.Y. Appl. Phys. Lett., 86, 264102 (2005).
- 3. Welsh G.H., Wynne K. Opt. Express, 17, 2470 (2009).
- 4. Майер С.А. Плазмоника: Теория и приложения (М.: R&C dynamics, 2011, с. 22).
- Kim S., Jin J., Kim Y.-I., Park Y.-J., Kim Y., Kim S.W. Nature, 453, 757 (2008).
- 6. Kadlec F., Kuzel P., Coutaz J.-L. Opt. Lett., 29, 2674 (2004).
- Kroo N., Farkas Gy., Dombi P., Varro S. Opt. Express, 16, 21656 (2008).
- Ионин А.А., Кудряшов С.И., Селезнев Л.В., Синицин Д.В., Емельянов В.И. Письма в ЖЭТФ, 97, 139 (2013).
- Parashar J., Pandey H.D., Tripathi V.K. J. Plasma Phys., 59, 97 (1998).
- 10. Wang X.Y., Downer M.C. Opt. Lett., 17, 1450 (1992).
- 11. Кудряшов С.И., Емельянов В.И. Письма в ЖЭТФ, 73, 751 (2001).
- 12. Lindgren T., Larsson J., Stenflo L. Plasma Phys., 24, 1177 (1982).
- 13. Фролов А.А. Физика плазмы, **33**, 206 (2007).
- 14. Гуржи Р.Н. *ЖЭТФ*, **35**, 965 (1957).